

**Bibliographic
data**

Description

Claims

[Mosaics](#)[Original
document](#)[INPADOC
legal status](#)

Publication number: JP2001358055

Publication date: 2001-12-26

Inventor: OKUMURA MASAHIKO

Applicant: NIPPON KOGAKU KK

Classification:

- international: *G03F7/20; H01L21/027; G03F7/20; H01L21/02; (IPC1-7): H01L21/027; G03F7/20*

- European: *G03F7/20T16; G03F7/20T24*

Application number: JP20000179549 20000615

Priority number(s): JP20000179549 20000615

[View INPADOC patent family](#)

[View list of citing documents](#)

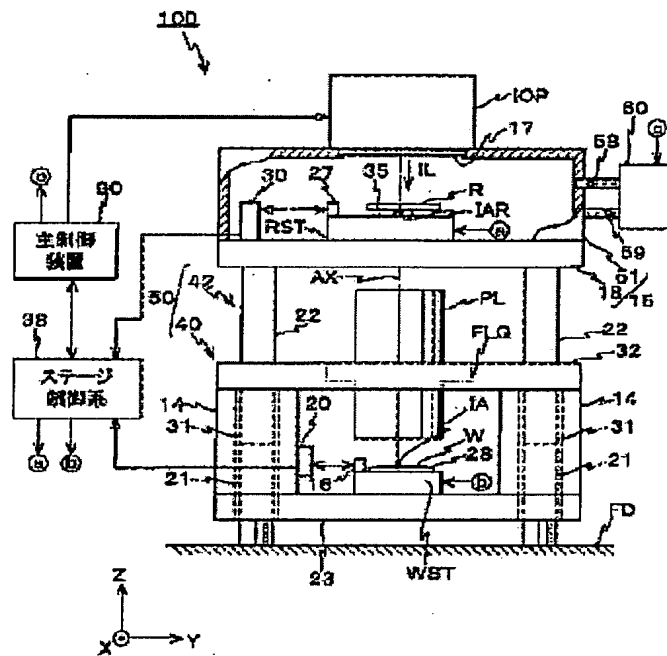
[Report a data error here](#)

Abstract of **JP2001358055**

PROBLEM TO BE SOLVED:

To provide an exposure apparatus for contributing to further improvement in throughput.

SOLUTION: A reticle stage RST has an electrostatic chuck 35 for attracting reticles R. A chamber 15 for containing the stage RST is provided, and humidity of an atmosphere in the chamber 15 is regulated to a predetermined value or less by a humidity regulator 60. Thus, even when the stage RST is driven at a high acceleration, the reticles R can be stably held by an attracting force of the chuck. When reduction projecting exposure is conducted by a scanning exposure system, large acceleration is required for the stage RST, and hence the stage RST at a scanning exposure time and a wafer stage WST can be highly accelerated at its speed, and the throughput can be improved by shortening the scanning exposure time.



(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号
特開2001-358055
(P2001-358055A)

(43)公開日 平成13年12月26日 (2001. 12. 26)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード(参考)
H 0 1 L 21/027		C 0 3 F 7/20	S 2 1 5 F 0 4 6
G 0 3 F 7/20	5 2 1	H 0 1 L 21/30	S 1 6 F
			S 0 3 A
			S 1 8

審査請求 未請求 請求項の数6 O L (全 17 頁)

(21)出願番号	特願2000-179549(P2000-179549)	(71)出願人	000004112 株式会社ニコン 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号
(22)出願日	平成12年6月15日(2000. 6. 15)	(72)発明者	奥村 正彦 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株 式会社ニコン内
		(74)代理人	100102901 弁理士 立石 篤司 Fターム(参考) 5F046 AA22 BA05 CC01 CC02 CC08 CC09 DA27 DB03

(54)【発明の名称】 露光装置及びデバイス製造方法

(57)【要約】

【課題】 スループットの更なる向上に寄与する露光装置を提供する。

【解決手段】 レチクルステージRSTが、レチクルRを吸着する静電チャック35を有している。また、レチクルステージRSTを収納するチャンバ15が設けられ、該チャンバ15内部の雰囲気湿度が湿度調整装置60により所定値以下に調整されている。このため、レチクルステージRSTを高加速度で駆動するときにも、静電チャックの吸着力によりレチクルRを安定して保持することができる。走査露光方式により縮小投影露光を行う場合は、レチクルステージRSTに大きな加速度が要求されるので、走査露光時のレチクルステージRSTとウエハステージWSTの高加速度化、高速化が可能となり、走査露光時間の短縮によりスループットの向上が可能である。

